

一种新颖的无显影光刻技术

摘要点击: 1705 全文下载: 888

[查看全文](#) [查看/发表评论](#) [下载PDF阅读器](#)

所在位置: 1980, 1(2): 162-162

中文关键词:

英文关键词:

基金项目:

PACC代码:

EEACC代码:

作者

单位

[裴荣祥](#)

[洪啸吟](#)

[韩阶平](#)

[金维新](#)

中文摘要:

光刻技术是制造半导体器件的重要工艺之一,自六十年代初,在半导体工业得到运用以来,大大促进了半导体器件和集成电路的发展,至今仍占有重要地位.随着半导体器件向更高频率和大规模集成的方向发展,要求器件的尺寸越来越小,

英文摘要:

您是第672374位访问者

主办单位: 中国电子学会, 中国科学院半导体研究所 单位地址: 北京市海淀区清华东路甲35号

Service Tel: 010-82304277, 82304311 Fax: 010-82305052 邮编: 100083 Email: cjs@semi.ac.cn

本系统由勤云电子有限公司设计,技术支持电话: 010-81928386, Email: et_yehu@yahoo.com.cn, 网址: <http://www.e-tiller.com>